

(別紙)

## 被告製品目録

1 Cr を 5 ～ 9 m o l % , Pt を 9 ～ 1 3 m o l % , 残余が Co である合金の金属素地 ( a ) に球形の相 ( b ) が分散する焼結体の磁気記録メディア用酸化物入りスパッタリングターゲット ( セミコン・ライト株式会社向け製品であって、被告社内の品名コードが 2 3 0 1 3 5 3 6 0 7 であるもの。 ) 。

2 ● (省略) ●

3

(1) シーゲイト・テクノロジー社, ウェスタンデジタル社, 昭和電工株式会社, 富士電機株式会社及び H G S T 社向けの磁気記録メディア用ターゲットであって, Cr を 2 0 m o l % 以下, Pt を 5 m o l % 以上 3 0 m o l % 以下, 残余が Co である合金と S i O<sub>2</sub>, T i O<sub>2</sub>, C r<sub>2</sub>O<sub>3</sub> のいずれかを含む酸化物からなる金属素地 ( a ) に, Co を 9 0 w t % 以上含有し, 直径が 3 0 ～ 1 5 0 μ m であって長径と短径の差が 0 ～ 5 0 % の球形の相 ( b ) がターゲット全体積又はターゲットのエロージョン面の面積の 2 0 % 以上分散する焼結体の磁気記録メディア用酸化物入りスパッタリングターゲット ( 但し, 上記 1 及び 2 に記載の製品を除く。 )

(2) シーゲイト・テクノロジー社, ウェスタンデジタル社, 昭和電工株式会社, 富士電機株式会社及び H G S T 社向けの磁気記録メディア用ターゲットの二相品 ( 複相品 ) ( 金属の粗粒を含有するターゲット ) ( 但し, 上記 1 及び 2 に記載の製品を除く。 )